

2018年2月5日

## AGC 旭硝子、EUV 露光用フォトマスクブランクス供給体制を大幅増強

AGC旭硝子（旭硝子株式会社、本社：東京、社長：島村琢哉）は、EUV露光用フォトマスクブランクの供給体制を、グループ会社であるAGCエレクトロニクス（本社：福島県郡山市、社長：落合克成）において、本年より大幅に増強することを決定しました。

電子機器の高機能・小型化が進むにつれ、半導体チップの計算処理の高速化、データの大容量化、高集積化が求められています。そのためには半導体チップの回路パターンを微細にする必要がありますが、現行の光リソグラフィ技術<sup>\*注1</sup>では、「7nm 世代」と呼ばれる半導体デバイスの微細なパターン形成は、理論上難しくなっています。この微細なパターン形成の最有力とされているのが、EUV<sup>\*注2</sup>露光技術です。

AGCはEUV露光技術で用いられるフォトマスクブランクス(以下 EUV マスクブランクス)の研究開発を、2003年に開始しました。AGCの保有するガラス材料技術、ガラス加工技術、コーティング技術などを統合し、現在では「ガラス材料」から「膜材料」までを一貫して手掛けることができる、世界で唯一の EUV マスクブランクスメーカーとなっています。今後主流になる EUV 露光技術の拡大を見据え、EUV マスクブランクの供給体制を、グループ会社である AGC エレクトロニクス社において、本年より大幅に増強することを決定しました。

AGCグループは、経営方針 **AGC plus** の下、エレクトロニクス事業を戦略事業のひとつと位置付けています。今後大きな需要の伸びが見込まれる EUV マスクブランクス事業に対し積極的な設備投資を実施し、半導体産業の発展に貢献していきます。

以上

### \*注釈

- 1) 光リソグラフィ技術：KrF(フッ化クリプトン)や ArF(フッ化アルゴン)光源を用いて、LSI 回路パターンをシリコンウエハ等に転写するプロセスのこと。
- 2) EUV：波長 13.5nm の極端紫外線のこと。

---

◎本件に関するお問い合わせ先：

AGC 旭硝子 広報・IR 部長 玉城 和美

(担当：北野 TEL: 03-3218-5603 E-mail: [info-pr@agc.com](mailto:info-pr@agc.com))

<ご参考>

■AGC エレクトロニクス社について■

社名	AGC エレクトロニクス株式会社
資本金	300 百万円
代表	落合 克成
本社所在地	福島県 郡山市
従業員数	600 名(2017 年 12 月末現在)
主な事業内容	半導体関連部材事業 光デバイス事業など

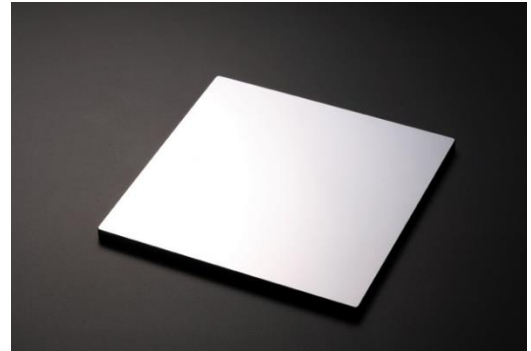


■EUV マスクブランクスについて■

EUV マスクブランクスとは、低膨張ガラス基板の表面に複数の組成から成る膜を積層した、「フォトマスク」の原版です。回路の微細化に伴い、EUV マスクブランクスに対する

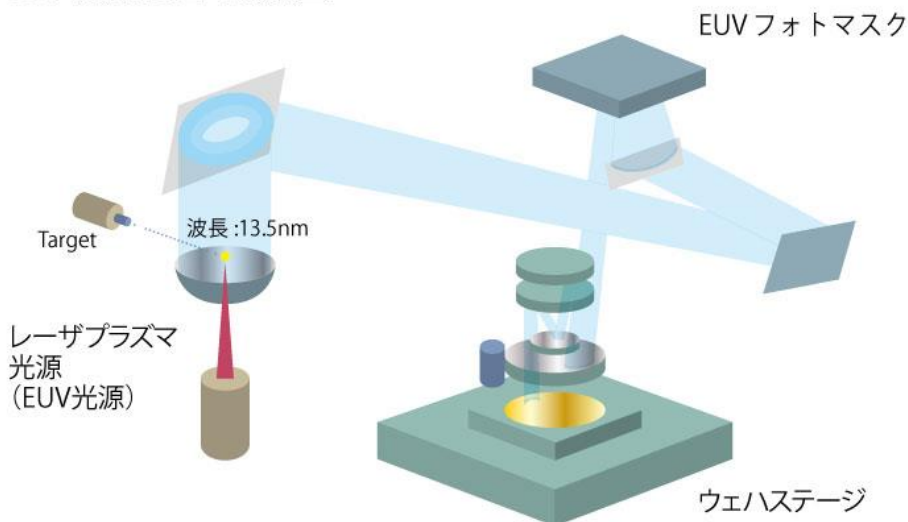
- ・非常に小さなサイズの欠陥を限りなくゼロに近づけること
- ・非常に高い平坦度であること

といった要求水準は、更に高くなっています。



**EUV マスクブランクス**

**EUV 露光装置の概観図**



◎本件に関するお問い合わせ先：

AGC 旭硝子 広報・IR 部長 玉城 和美

(担当：北野 TEL: 03-3218-5603 E-mail: [info-pr@agc.com](mailto:info-pr@agc.com))